

基盤技術別の知的財産活動概略

1. 基盤技術の国内、国外における公開特許件数の推移

(1) 国内

国内における公開特許件数は「光学技術」について前年比増加となりました。「電子映像技術」、「精密技術」、「生体基盤技術」は若干の減少が見られましたが、概ね近年同様の公開件数となりました。

(2) 国外

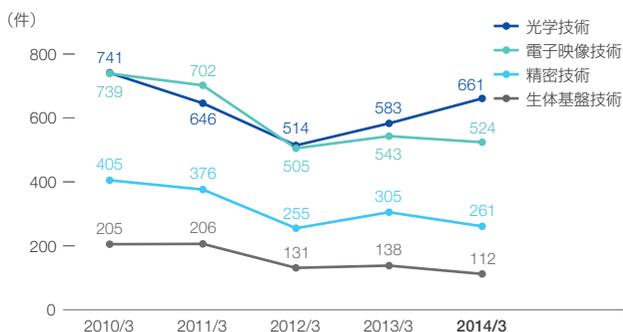
国外出願増強施策により、国外における公開特許件数は「光学技術」「電子映像技術」「精密技術」「生体基盤技術」のいずれの技術領域においても増加しました。米国、中国をはじめグローバルな特許網の構築を推進しています。

2. 保有特許全体に占める基盤技術の割合

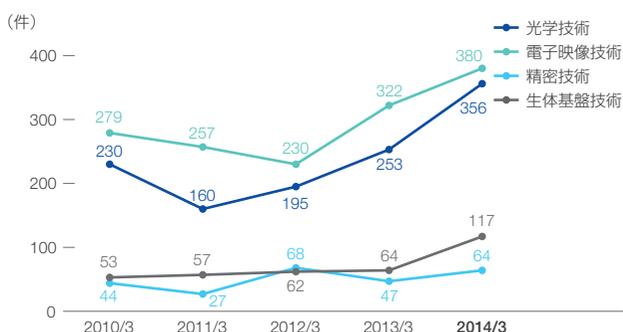
基盤技術が国内外保有特許全体に占める割合は59%で前期と同様です。

各基盤技術が全体に占める割合も大きな変化はなく、「光学技術」と「電子映像技術」で全体の46%を占めています。

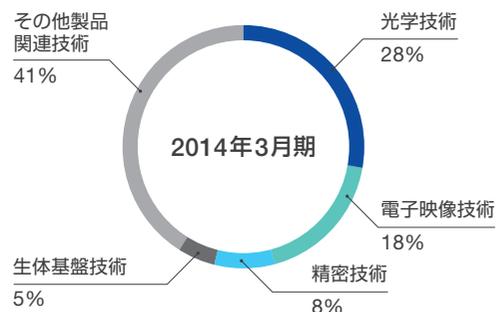
基盤技術の国内公開特許件数の推移



基盤技術の国外公開特許件数の推移



保有特許全体に占める基盤技術の割合



国別の保有特許件数

最近5年間における国別の保有特許件数の推移は右の通りです。前期に引き続き、国外における特許取得件数を増大させていく方針のもと、権利化活動を進めています。

2014年3月期における保有特許件数は、国内で前期に比べ8%の増加、国外は5%の増加となりました。

国別の保有特許件数の推移

